

公募案内（リサーチインフラ・マネジメント機構 技術専門員）

所属	リサーチインフラ・マネジメント（RIM）機構 コアファシリティセンター マイクロプロセス部門
職名	技術専門員
人数	1名
専門分野	ナノ・マイクロ科学、応用物理学、電気・電子、機械、工学一般
職務内容	職務内容 学内外の利用研究室との連携・調整およびメカノマイクロプロセス室運営に関わる幹事業務 クリーンルーム設備の管理・技術支援担当 当センターでは、MEMS、材料、バイオ研究などに用いる多様なマイクロデバイスの製作を支援する共用クリーンルームを運営しています。 現在、このクリーンルームに設置された各種微細加工装置・評価装置の管理・運用および技術指導を担う技術系職員を募集しています。 主な業務内容 ・ 微細加工装置（例：エッチング装置、成膜装置、露光装置など）および評価装置（例：レーザー顕微鏡、SEM、AFM、触針式プロファイラーなど）の保守・管理 ・ 上記装置を用いたマイクロデバイス製作支援および利用者への技術指導 ・ クリーンルームの維持管理（環境モニタリング、設備点検、安全管理 など） 大学教員・学生・企業の多様な利用者と連携しながら、最先端の研究開発を技術面から支える業務です。 採用後は、RIM 機構コアファシリティセンター マイクロプロセス部門に所属し、スタッフと協力してメカノマイクロプロセス室の運営管理を円滑に進めるための業務に携わっていただきます。 コアファシリティセンターおよびマイクロプロセス部門に関する情報は以下ホームページを参照のこと。 https://www.ofc.titech.ac.jp/ マイクロプロセス部門・リサーチインフラ・マネジメント機構（CFC TCC） * 業務内容・業務場所については、今後、組織の変更・業務の分担の変更に伴い変わる可能性があります。詳細は下記”問合せ先”までお問い合わせください。
応募資格	応募資格 ・ 大学または高等専門学校を卒業、あるいはそれと同等以上の学歴を有する方。 ・ ものづくりに興味を持ち、主体的に業務に取り組む意欲のある方。 ・ 半導体などのデバイス加工・評価、真空装置や高圧ガスの取扱いに関する基礎的な知識を有していることが望ましい。

	・新しいプロセスや技術に積極的に取り組む姿勢をお持ちの方。ソフトウェアや設計ツールの利用経験があることが望ましいですが、必須ではありません。 ・クリーンルームの維持管理に必要な技術に理解を示し、実務に積極的に取り組む意欲のある方。 ・学生や教職員をはじめとする利用者と円滑に連携できるコミュニケーション能力を有する方。 ただし、次の者は試験を受けられません。 （１）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 （２）懲戒解雇又はこれに相当する処分を受けたことのある者で、その処分から２年を経過していない者 （３）日本国内における活動に制限のない在留資格を有しない者 ※日本国籍以外の国籍のみ有する方は、以下の在留資格以外の場合はお申込みいただけません。なお、以下に該当する方には後日、在留カードなど、在留資格が確認できる証明書等の写しを提出していただきます。 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」 （「出入国管理及び難民認定法（昭和２６年１０月４日政令第３１９号）」別表第二参照） <u>在留資格は、応募時点で保有している必要があります。</u>
勤務予定地	すずかけ台キャンパス（神奈川県横浜市緑区長津田町 4259） 採用後、職務上の異動に伴い大岡山キャンパス（東京都目黒区大岡山 2-12-1） 田町キャンパス（東京都港区芝浦 3-3-6） 勤務になることもあります。
勤務時間等	勤務時間、休暇等は、「国立大学法人東京科学大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程」に定められています。 ① １日の標準勤務時間（７時間 45 分）としたフレックスタイム制 始業時間帯 7:00～10:30 まで コアタイム 10:30～15:30 休憩時間 12:15～13:15（１時間） 終業時間帯 15:30～22:00 まで ② 超過勤務の有無：有 ③ 休日：土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） ④ 有給休暇およびその他の休暇制度あり
任期	任期無し（定年年齢 65 歳。但し、これまで 60 歳の定年を、令和 5 年度より 2 年に 1 歳ずつ段階的に 65 歳まで引き上げるため、引上げ中（～令和 12 年度）の定年は生年月日により異なります。
試用期間	6 ヶ月（業務内容及び労働条件同じ）
給与	国立大学法人東京科学大学職員賃金規程による

社会保険等	厚生年金，共済（短期），雇用保険，労災保険
福利厚生	文部科学省共済組合へ加入することになり，短期給付事業（病気，けが等を受けた組合員に対する給付），長期給付事業（年金），福祉事業（保養施設の利用，貯金等）が受けられます。
雇用主	国立大学法人東京科学大学理事長
採用予定時期	令和８年１月１日以降，できるだけ早い時期
応募締切	令和７年１０月１日（水）１７時必着
選考方法	第１次選考：書類審査　　第２次選考：面接試験
応募書類	１）履歴書（市販の履歴書（A4 サイズ）に自筆で記入，写真貼付，学歴は高校卒業から記載）＊必ずメールアドレスを記入してください ２）志望動機と抱負（A4 用紙１枚程度） ３）職務内容調書 これまでの研究支援の実務経験ならびに関連する研究業績などを記載ください。
書類提出方法	封筒に「RIM 技術専門員（CFC マイクロプロセス部門） 応募書類在中」と朱書きし，持参または簡易書留で郵送して下さい。 Email 等での受け付けはしておりません。
書類送付先	〒226-8501 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 G3-37 東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構研究基盤戦略室 室長補佐 高橋 久徳
問合せ先	東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構研究基盤戦略室 室長補佐 高橋 久徳 e-mail : rim-saiyo@rim.isct.ac.jp 件名に「技術専門員公募」の文言を含むこと
その他	(1) 応募書類等の返却はしません。応募書類に含まれる個人情報 は国立大学法人東京科学大学の定めに従い，本職員採用にのみ使用し，他の目的には一切使用しません。 (2) 敷地内禁煙（ただし，屋外指定箇所に喫煙場所設置）